Mikroelektronik II Formelsammlung

Inhaltsverzeichnis

1	\mathbf{Mik}	roelektronik II	3
	1.1	Allgemeines	3
		1.1.1 Spezifischer Widerstand	3
		1.1.2 Elektrostatik	3
	1.2	PN Übergang	3
		1.2.1 Quasi-Fermi-Niveaus (QFN oder Imref)	3
		1.2.2 Diffusionsspannung und Weite der RLZ	4
		1.2.3 Feldstärke	5
		1.2.4 Massenwirkungsgesetz	5
		1.2.4.1 Umformulierungen	5
		1.2.5 Energiebetrachtung	5
	1.3	Bohrsches Atommodell	6
		1.3.1 Energie	6
	1.4	Bipolartransistor	7
		1.4.1 Leistung	7
		1.4.2 Emitterwirksamkeit/Transportfaktor	7
		1.4.3 Verstärkung	8
	1.5	MOSFET	8
		1.5.1 Leistung	8
		1.5.2 Gate Kapazität	8
		1.5.3 Takt	8
2	Anl	ıänge	9
	$\overline{2.1}$	Abkürzungen/Formelzeichen	9
	2.2	Wichtige Donatoren und Akzeptoren	11
	2.3	Effektive Massen	12
	2.4	Bandlücken wichtiger Materialien	12
	2.5	Eckdaten wichtiger Halbleiter	12
	2.6	Niederfeld- und Niederdotierungsbeweglichkeiten $(T = 300K)$	13
	2.7	Konstanten	13
	2.8	Nachwort	14
3	Lite	eratur	14

Versionierung

Datum	Vers.	Kürzel	Änderung
28.08.2018	0.1	FL	Erzeugung Dokument; Erzeugung Inhaltsver-
			zeichnis; Erzeugung Versionierung; Erzeugung
			Allg., PN Üb., Bohrsch., Bipol., MOSFET
29.08.2018	0.3	FL	Korrektur Ionisationsenergie(d,e); erzeugt In-
			versionsspannung(a,b)

1 Mikroelektronik II

1.1 Allgemeines

1.1.1 Spezifischer Widerstand

Ohmsches Gesetz :
$$V = RI[V]$$
 (1.1.1)

Widerstand :
$$R = \frac{V}{I}[\Omega]$$
 (1.1.2)

Leitwert :
$$G = \frac{1}{G} = \frac{I}{V} \left[\frac{1}{\Omega} = S \right]$$
 (1.1.3)

Spezifischer Widerstand :
$$R = \rho_{\overline{A}}^{L} [\Omega]$$
 (1.1.4)

Leitfähigkeit(a) :
$$\sigma \frac{A}{L}[S]$$
 (1.1.5)

Leitfähigkeit(b) :
$$\sigma = \frac{1}{a}$$
 (1.1.6)

1.1.2 Elektrostatik

Poisson Gleichung(a) :
$$\Delta \varphi(\vec{r}) = \frac{\varrho_{\mathcal{Q}}(\vec{r})}{\varepsilon}$$
 (1.1.7)

Poisson Gleichung(b) :
$$\nabla \vec{\varepsilon}(\vec{r}) = -\frac{\varrho_Q(\vec{r})}{\varepsilon}$$
 (1.1.8)

El. Feld :
$$\vec{\varepsilon}(\vec{r}) = -\operatorname{grad}\varphi(\vec{r}) = -\vec{\nabla}(\vec{r})$$
 (1.1.9)

Coulomb Kraft :
$$\overrightarrow{F_c}(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 (1.1.10)

1.2 PN Übergang

1.2.1 Quasi-Fermi-Niveaus (QFN oder Imref)

Elektronenkon-
zentration :
$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{kT}}$$
 (1.2.1)

Lochkonzentration :
$$p = N_V e^{-\frac{E_{Fp} - E_V}{kT}}$$
 (1.2.2)

Massenwir-
$$: np = N_C N_V e^{\frac{E_g}{kT}} e^{\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}}$$

1.2.2 Diffusionsspannung und Weite der RLZ

Flächenladung gesamt :
$$G_{F,total} = Q_L + Q_R = 0$$
 (1.2.4)

$$=-qN_Ad_p+qN_Dd_n$$

Folgerung aus
$$(1.2.4)(a) : N_A d_p = N_D d_n (1.2.5)$$

Weite(a) :
$$w = d_n + d_p$$
 (1.2.7)

Diffusions span-
nung(a) :
$$V_{bi} = \varphi_R(d_n) = -\frac{\varepsilon_{max}}{2}(d_n + d_p) = -\frac{\varepsilon_{max}}{2}w$$
 (1.2.8)

Mit (1.2.23) erhält man

Diffusions span-

$$\operatorname{nung}(b) : V_{bi} = \frac{qN_A}{2\varepsilon_d} d_p(d_n + d_p)$$
(1.2.9)

Mit (1.2.5) erhält man schließlich

Teilweite
$$d_n$$
 : $d_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_d N_A V_{bi}}{q N_D (N_A + N_D)}} \sim \sqrt{V_{bi}}$ (1.2.10)

Teilweite
$$d_p$$
 : $d_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_d N_D V_{bi}}{q N_A (N_A + N_D)}} \sim \sqrt{V_{bi}}$ (1.2.11)

Bei angelegter ext. Spannung gilt bei (1.2.10) und (1.2.11) $V_{bi,neu} = V_{bi} + V_{DS}$.

Weite(b) :
$$w = dp \left(1 + \frac{N_A}{N_D}\right)$$
 (1.2.12)

Weite(c) :
$$w = \sqrt{\frac{2\varepsilon_d}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D}} V_{bi} \sim \sqrt{V_{bi}}$$
 (1.2.13)

Weite Schottky :
$$w = x_{n,p} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_d |\Phi_{MS}|}{qN_D}}$$
 (1.2.14)

Folgerung(a) :
$$w \uparrow \Rightarrow V_{bi} \uparrow$$
 (1.2.15)

Diffusionsspan-

$$\operatorname{nung}(c) : qV_{bi} = kT \ln \left(\frac{n_{n0}p_{p0}}{n_i^2} \right) \approx kT \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$
(1.2.16)

Diffusions span-

$$\operatorname{nung}(\mathbf{d}) \qquad : \quad V_{bi}^{0} = \frac{kT}{q} ln\left(\frac{N_{D}N_{A}}{n_{i}^{2}}\right)$$
(1.2.17)

Diffusions span-

$$\operatorname{nung}(e) : V_{bi} = V_{bi}^{0} - V$$
(1.2.18)

Diffusions span-

$$\operatorname{nung}(f) : V_{bi} = \frac{q}{2\varepsilon_d} (N_A x_p^2 + N_D x_n^2)$$
(1.2.19)

us (1.2.5) und (1.2.7) folgen

Relative Weite
$$p$$
: $d_p = w \frac{N_D}{N_A + N_D}$ (1.2.20)

Relative Weite
$$n$$
: $d_n = w \frac{N_A}{N_A + N_D}$ (1.2.21)

Flächenladungs-

dichte :
$$Q_F = |Q_R| = |Q_L| = qN_A d_p = qN_D d_n$$

= $q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} w = \sqrt{2\varepsilon_d \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} q V_{bi}}$ (1.2.22)

1.2.3Feldstärke

Maximale el. Feldstärke(a) :
$$\varepsilon_{max} = \varepsilon(x=0) = \varepsilon_{L,R}(x=0)$$
 (1.2.23)

Maximale el. Feldstärke(b) :
$$|\boldsymbol{\varepsilon}_{max}| = 2\frac{V_{bi}}{w} = \frac{qN_{D,A}}{\varepsilon_d}x_{n,p}$$
 (1.2.24)

Massenwirkungsgesetz 1.2.4

Massenwir-
kungsgesetz(a) :
$$np = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}} e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}}$$
 (1.2.25)

Bandlücke :
$$E_q = E_C - E_V$$
 (1.2.26)

(1.2.26) in (1.2.25) (wobei n_i die intrinsische Ladungsträgerdichte ist):

Massenwir-
kungsgesetz(b) :
$$np = N_C N_V e^{\frac{E_g}{kT}} = n_i^2$$
 (1.2.27)

Also gilt ganz allgemein (und zwar unabhängig von der Dotierung)

Massenwir-
kungsgesetz(c) :
$$np = n_i^2$$
 (1.2.28)

Intrinsische

Ladungsträger- :
$$ni = \sqrt{N_C N_V} \cdot e^{-\frac{E_g}{2kT}}$$
 (1.2.29) dichte

1.2.4.1 Umformulierungen

$$E_C - E_F$$
 : $E_C - E_F = kT \cdot ln\left(\frac{N_C}{n}\right)$ (1.2.30)

$$E_F - E_V \qquad : \quad E_F - E_V = kT \cdot \ln\left(\frac{N_V n}{n^2}\right) \tag{1.2.31}$$

Energiebetrachtung 1.2.5

Austrittsarbeit :
$$\Phi_{MS} = \Phi_M - \Phi_S$$
 (1.2.32)

Austrittsarbeit
b) :
$$V_{bi} = \Phi_{MS}$$
 (1.2.33)

1.3 Bohrsches Atommodell

1.3.1 Energie

Energie i-te
Schale :
$$E_i = -\frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{r_i}$$
 (1.3.1)

Energie Schalen-
übergang(a) :
$$E_{ae} = E_a - E_e = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_e} - \frac{1}{r_a}\right)$$
 (1.3.2)

Bahnradius(a),
Bohrscher :
$$r_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{q^2m}$$
 (1.3.3)
Radius

Bahnradius(b) :
$$r_i = n^2 \cdot r_1$$
 (1.3.4)

Energie Schalen-
übergang(b) :
$$E_{ae} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2 m}{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2} \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_a^2}\right)$$
 (1.3.5)

Frequenz Schalenübergang(a) :
$$f_{ae} = \frac{mg^4}{(4\pi\hbar)^3 \varepsilon_0^2} \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_a^2}\right)$$
 (1.3.6)

Rydberg-Ritz :
$$\frac{1}{\lambda_{ae}} = \frac{mg^4}{(4\pi\hbar)^3 \varepsilon_0^2 C_0} \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_a^2}\right)$$
 (1.3.7)

Rydberg
$$: R_{\infty} = \frac{mg^4}{(4\pi\hbar)^3 \varepsilon_0^2 C_0} = \frac{mq^4}{8h^3 \varepsilon_0^2 C_0}$$
 (1.3.8)

Wellenlänge Schalenüber- :
$$\lambda_{ae} = \left(R_{\infty} \left(\frac{1}{n_e} - \frac{1}{n_a}\right)\right)^{-1}$$
 (1.3.9) gang(a)

Für wasserstoffähnliche Atome wird die Rydberg Ritz Formel angepasst:

Rydberg-Ritz Formel(b) :
$$\frac{1}{\lambda_{ae}} = R_{\infty} Z^2 \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_a^2} \right)$$
 (1.3.10)

wobei für Z die Kernladungszahl einzusetzen ist, was bei wasserstoffähnlichen Atomen die Ordnungszahl ist.

Bahngeschwindigkeit :
$$v_i = \frac{\hbar}{mr_i}$$
 (1.3.11)

Ionisationsener-
gie(a) :
$$E_{n\infty} = -R_{\infty}hC_0\frac{1}{n^2}$$
 (1.3.12)

Ionisationsener-
gie(b) :
$$E_{1\infty} = -R_{\infty}hC_0$$
 (1.3.13)

Ionisationsener-
gie(c) :
$$E_{1\infty} = -R_{\infty}hC_0Z^2$$
 (1.3.14)

Schale :
$$n = \sqrt{-\frac{R_{\infty}hC_0}{E_{n\infty}}}$$
 (1.3.15)

Kernladungs-
zahl :
$$Z = \sqrt{\frac{1}{\lambda_{ae}R_{\infty}} \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_a^2}\right)^{-1}}$$
 (1.3.16)

Betrachtet man ein in ein anderes Element eingebrachtes Elektron müssen die Zusammenhänge angepasst werden.

Bahnradius(c) :
$$r_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{rel}\hbar^3}{q^2m^*}$$
 (1.3.17)

Ionisationsenergie(d) :
$$E_{ae} = R_{\infty}hC_0 \frac{m^*}{m_0 \cdot \varepsilon_{rel}^2} \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_a^2}\right)$$
 (1.3.18)

Ionisationsener-
gie(e) :
$$E_{1\infty} = -R_{\infty}hC_0 \frac{m^*}{m_0 \cdot \varepsilon_{rel}^2}$$
 (1.3.19)

1.4 Bipolartransistor

1.4.1 Leistung

Leistung(a) :
$$P_{BT} \cong \frac{N}{2} I V_{cc} + N \frac{I}{\beta} V_{cc}$$
 (1.4.1)

Leistung(b) :
$$P_{BT} \cong \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\beta}\right) NIV_{cc} = \frac{2+\beta}{2\beta} NIV_{cc}$$
 (1.4.2)

1.4.2 Emitterwirksamkeit/Transportfaktor

Emitterwirk-
samkeit(a) :
$$\alpha_E = \frac{I_n}{I_n + I_p}$$
 (1.4.3)

Emitterwirk-
samkeit(b) :
$$\alpha_e = \frac{1}{1 + \frac{L_n D_p N_A^{(B)}}{L_n D_n N_A^{(E)}}}$$
 (1.4.4)

Emitterstrom :
$$|I_E| = A_q D_b \frac{n(0) - 0}{w_B}$$
 (1.4.5)

Basisstrom :
$$|I_B| = Aq \frac{n(0)w_b}{2} \frac{1}{\tau_n}$$
 (1.4.6)

Transportfaktor :
$$\alpha_T = \frac{|I_C|}{|I_B|} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{w_B}{L_n}\right)^2$$
 (1.4.7)

Diffusionslänge Löcher :
$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$
 (1.4.8)

Diffusionslänge Elektronen :
$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$
 (1.4.9)

1.4.3 Verstärkung

Stromverstär-
kung :
$$\beta_0 = \frac{I_C}{I_B}$$
 (1.4.10)

Stromverstär-

kung Emitterschal:
$$\beta_0 = \frac{I_C}{I_E - I_C} = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = \frac{\alpha_E \alpha_T}{1 - \alpha_E \alpha_T}$$
 (1.4.11) tung

1.5 MOSFET

1.5.1 Leistung

Leistung(a) :
$$P_{NMOS} \cong \frac{N}{2} I V_{cc} + N I_{dyn} V_{cc}$$
 (1.5.1)

Leistung(b) :
$$P_{CMOS,ideal} \cong NC_L f V_{cc}^2$$
 (1.5.2)

Hierbei gilt I_{dyn} (MOSFET) $< \frac{I}{\beta}$ (BPT).

Dyn. Strom :
$$I_{dyn} = fC_L V_{cc}$$
 (1.5.3)

Power-Delay-
Produkt :
$$\frac{P_{CMOS,ideal,max}}{C_l V_{cc}^2} = N f_{max} = konst.$$
 (1.5.4)

1.5.2 Gate Kapazität

Umladege-
schwindigkeit :
$$v_D = \mu \varepsilon = \mu \frac{V_{DS}}{L}$$
 (1.5.5)

Steilheit :
$$g_m = \frac{WC_{gox\mu}}{L}$$
 (1.5.6)

Umladedauer(a) :
$$\tau_L = \frac{L^2}{\mu V_{DS}}$$
 (1.5.7)

Umladedauer(b) :
$$\tau_L = \frac{WC_{gox}L}{g_m}$$
 (1.5.8)

Inversions spannung (a) :
$$V_{sl} = \frac{d_I}{\varepsilon} \left(2q \left(\sqrt[3]{N_A} \right)^2 + \sqrt{q N_A \varepsilon \beta ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)} \right) + \beta ln \left(\frac{N_A}{N_i} \right)$$
 (1.5.9)

Inversions
spannung(b) :
$$V_{Sl} = V_{Isolator} + V_{T,ideal} = V_{Isolator} + 2\Psi_B$$
 (1.5.10)

1.5.3 Takt

Taktfrequenz :
$$f_T = \frac{1}{2\pi\tau_L} = \frac{1}{2\pi} \frac{g_m}{WC_{gax}L}$$
 (1.5.11)

2 Anhänge

${\bf 2.1} \quad {\bf Abk\"{u}rzungen/Formelzeichen}$

Zeichen	Einheit	Bedeutung
A	m^2	Fläche
a	$\frac{m}{s^2}$	Beschleunigung
b	$\frac{cm^2}{Vs}$	Ladungsträgerbeweglichkeit
d	m	Dicke
D_n	$\frac{m^2}{s}$	Diffusionskonstante für Elektronen
D_p	$\frac{m^2}{s}$	Diffusionskonstante für Löcher
e	C	Elementarladung
E	$\frac{N}{C} = \frac{VAs}{mAs} = \frac{V}{m}$	Elektrische Feldstärke
E_c	eV	Leitungsbandkante
E_F	eV	Fermi-Energie
E_g	eV	Energie der Bandlücke
E_v	eV	Valenzbandkante
f	Hz	Frequenz
$ec{F}$	$N = \frac{kgm}{s^2}$	Kraft
G	$\frac{A}{V} = \frac{1}{\Omega} = S$	Leitwert
h	eVs	Plank-Konstante
\hbar	eVs	Planksches Wirkungsquantum
i	A	Elektrischer Strom
j	$\frac{A}{m2}$	Elektrische Stromdichte
J_n	$\frac{A}{m2}$	Elektronenstromdichte
J_p	$\frac{A}{m2}$	Löcherstromdichte
J_{diff}	$\frac{A}{m2}$	Diffusionsstromdichte
J_{part}	$\frac{A}{m2}$	Partikelstromdichte
J_to	$\frac{A}{m2}$	Totale Stromdichte
J_r	$\frac{A}{m2}$	Rekombinationsstromdichte

Fortsetzung auf Folgeseite

 ${\bf Tabelle~1:~Abk\"{u}rzungen/Formelzeichen}$

Zeichen	Einheit	Bedeutung
J_{drift}	$\frac{A}{m2}$	Driftstromdichte
l	m	Länge
L	m	Minoritätsladungsträgerdiffusionslänge
L_n	m	Diffusionslänge Elektronen
L_p	m	Diffusionslänge Löcher
n		Elektronenkonzentration
n_i		Intrinsische Ladungsträgerdichte
n_{id}		Idealität einer Diode
N_A	m^{-3}	Akzeptorendichte
N_D	m^{-3}	Donatorendichte
N_C	cm^{-3}	Effektive Zustandsdichte der Elektronen
N_V	cm^{-3}	Effektive Zustandsdichte der Löcher
p		Lochkonzentration
q	C	Probeladung (in der Regel $= e$)
\vec{r}	m	Weg
r	Ω	Differentieller Widerstand
R	Ω	Widerstand
R_F	$\frac{\Omega}{square}$	Flächenwiderstand
U	V	Elektrische Spannung
U_g	V	Gesamtspannung
v	$\frac{m}{s}$	Geschwindigkeit
v_D, v_d	$\frac{m}{s}$	Driftgeschwindigkeit
\overline{w}	m	Weite bzw. Breite
\overline{W}	$Ws = J = \frac{kgm^2}{s^2}$	Arbeit bzw. Energie
α	$\frac{1}{\circ C}$	Temperturkoeffizient des Ohmwiderstandes
ν	Hz	Hier Frequenz der Welle
ρ	$\frac{Vcm}{A} = \Omega cm$	Spezifischer Widerstand

Fortsetzung auf Folgeseite

 ${\bf Tabelle~1:~Abk\"{u}rzungen/Formelzeichen}$

Zeichen	Einheit	Bedeutung
$ ho_e$		Ladungsdichte
κ	$\frac{1}{\Omega cm} = \frac{S}{cm}$	Spezifische Leitfähigkeit
ε_0	$\frac{As}{Vm}$	Dielektrizitätskonstante im Vakuum
φ	V	Elektrisches Potential
τ	S	Stoßzeit
τ	S	Minoritätsladungsträgerlebensdauer
μ	$\frac{cm^2}{Vs}$	Beweglichkeit

2.2 Wichtige Donatoren und Akzeptoren

Ch. Sym.	Name	Тур
В	Bor	Akzeptor
Al	Alluminium	Akzeptor
Ga	Gallium	Akzeptor
In	Indium	Akzeptor
P	Phosphor	Donator
As	Arsen	Donator
Sb	Antimon	Donator
Bi	Wismut	Donator

2.3 Effektive Massen

Band	Wert	Element
$\frac{m_n^*}{m_0}$	1,08	Silizium
$\frac{m_n^*}{m_0}$	1,561	Germanium
$\frac{m_n^*}{m_0}$	1,067	Gallium-Arsenid
$\frac{m_p^*}{m_0}$	1,10	Silizium
$\frac{m_p^*}{m_0}$	1, 291	Germanium
$\frac{m_p^*}{m_0}$	1,473	Gallium

2.4 Bandlücken wichtiger Materialien

Zeichen	Wert in eV	Material
E_{g,SiO_2}	9	Siliziumdioxid
$E_{g,C}$	5,47	Diamant
$E_{g,CdS}$	2,42	Cadmiumsulfid
$E_{g,GaP}$	2,26	Galliumphosphid
$E_{g,GaAs}$	1,42	Gallium-Arsenid
$E_{g,InP}$	1,35	Indiumphosphid
$E_{g,Si}$	1,12	Silizium
$E_{g,Ge}$	0,66	Germanium
$E_{g,InSb}$	0, 17	Indiumantimonid

2.5 Eckdaten wichtiger Halbleiter

Ch. Sym.	E_g in $[eV]$	N_C in $[cm^{-3}]$	N_V in $[cm^{-3}]$	n_i in $[cm^{-3}]$
Si	1,124	$2,81 \cdot 10^{19}$	$2,88 \cdot 10^{19}$	$1,04 \cdot 10^{10}$
Ge	0,67	$1,05 \cdot 10^{19}$	$3,92 \cdot 10^{18}$	$1,55 \cdot 10^{13}$
GaAs	1,424	$4,33 \cdot 10^{17}$	$8,13\cdot 10^{18}$	$2,04 \cdot 10^6$

2.6 Niederfeld- und Niederdotierungsbeweglichkeiten (T = 300K)

n/p	Si	Ge	GaAs
$\mu_n \left[\frac{cm^2}{Vs} \right]$	1340	3900	8000
$\mu_p \left[\frac{cm^2}{Vs} \right]$	460	1900	400

2.7 Konstanten

Ze.	Wert	Bedeutung	
c	$2,998\cdot 10^8 [fracms]$	Lichtgeschwindigkeit	
e,q	$1,602176\cdot 10^{-19} [C]$	Elementarladung	
h	$6,63 \cdot 10^{-34} [Js]$	Planck-Konstante	
h	$4,136\cdot 10^{-15} [eVs]$	Planck-Konstante	
\hbar	$\frac{h}{2\pi}$	Plancksches Wirkungsquantum	
k	$8,6173 \cdot 10^{-5} \left[\frac{eV}{K} \right]$	Boltzmann Konstante	
kT	25,85[meV]	mit der Boltzmann Konstante und $T=300K$	
m_0	$9,11\cdot 10^{-31} [kg]$	Elektronenmasse	
m_{si}^*	$0, 2 \cdot m_0$	Effektive Masse Silizium	
m_{ge}^*	$0, 1 \cdot m_0$	Effektive Masse Germanium	
N_V	$1,04\cdot 10^{19}cm^{-3}$	Zustandsdichte im VB Silizium	
N_C	$2,80\cdot 10^{19}cm^{-3}$	Zustandsdichte im LB Silizium	
R	$1,09737\cdot 10^7 m^{-1}$	Rydbergkonstante	
ε_0	$8,854\cdot 10^{-12} \left[\frac{As}{Vm}\right]$	Dielektrizitätskonstante des Vakuuums	
$arepsilon_{Si}$	11,90	Korrekturfaktor Dielektrizitätskonstante für Silizium	
$arepsilon_{Ge}$	16	Korrekturfaktor Dielektrizitätskonstante für Germanium	
$arepsilon_{Si0_2}$	3,9	Korrekturfaktor Dielektrizitätskonstante für Si02	

2.8 Nachwort

Diese Formelsammlung wurde nahezu ausschließlich auf Basis des Mikroelektronik-I Scripts von Prof. Dr. Jürgen H. Werner und der Mikroelektronik 2 Vorlesung von Prof. Dr. habil. Jörg Schulze erstellt. Nahezu sämtliche Formeln und Werte sind direkt dem Script und der Vorlesung entnommen und wurden nicht für diese Sammlung eigenständig hergeleitet. Für ausführlichere Beschreibungen empfehle ich sehr das eben angesprochene Script zu studieren, dass unter (Werner 2017) im Literaturverzeichnis zu finden ist. Es kann direkt im "Kopierlädle"der Universität Stuttgart gedruckt werden. Diese Formelsammlung ist einzige ein Hilfsmittel für mich und meine Kommilitonen und sehr wahrscheinlich nicht fehlerfrei. Sollten Fehler gefunden werden, würde ich mich sehr freuen wenn man mir das kurz in einer E-Mail (f.leuze@outlook.de) mitteilen würde, damit ich entsprechende Korrekturen vornehmen kann.

3 Literatur

Werner, P. D.-N. J. H. (2017), Mikroelektronik I. Vorlesungsscript.